【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成19年9月6日(2007.9.6)

【公表番号】特表2007-510184(P2007-510184A)
【公表日】平成19年4月19日(2007.4.19)
【年通号数】公開・登録公報2007-015
【出願番号】特願2006-538353(P2006-538353)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｆ　1/15　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｆ　1/15　５０６

【手続補正書】
【提出日】平成19年7月19日(2007.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
－前面及び背面を有する実質的に透明な第一の素子であって、自浄親水性塗膜が前記前面の少なくとも一部に適用され、更に導電性物質が前記背面の少なくとも一部に適用されている第一の素子、
－前面及び背面を有する第二の素子であって、導電性物質が前記前面の少なくとも一部に適用されている第二の素子、
－前記第一及び第二の素子間に位置する室内に含まれるエレクトロクロミック媒体、及び
－前記自浄親水性塗膜の表面に適用された耐酸層、
を含むことを特徴とするエレクトロクロミックデバイス。
【請求項２】
更に、少なくとも高反射率状態及び低反射率状態を示すように加電圧に応じて変化する反射率を有する可変反射率ミラー素子を有する請求項１に記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項３】
前記エレクトロクロミック媒体が、１種以上の溶剤、陽極物質、及び陰極物質を含む請求項１又は２に記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項４】
前記耐酸層が、酸化錫インジウムを含む請求項１～３のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項５】
前記耐酸層のSn対Inの割合が、約１０:９０質量％より大きい請求項４記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項６】
前記耐酸層のSn対Inの割合が、約２０:８０質量％より大きい請求項４記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項７】
前記耐酸層のSn対Inの割合が、約３５:６５質量％より大きい請求項４記載のエレクトロクロミックデバイス。

【請求項８】
前記耐酸層のSn対Inの割合が、約９０：１０質量％より大きい請求項４記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項９】
前記耐酸層が、酸化錫を含む請求項１～３のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１０】
前記耐酸層が、酸化ケイ素を含む請求項１～３のいずれかに記載の可変反射率バックミラー。
【請求項１１】
前記耐酸層が、酸化ケイ素ジルコニウムを含む請求項１～３のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１２】
前記ミラーが、低反射率状態において約２０未満のC^*値を示す請求項２～１１のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１３】
前記ミラーが、高反射率状態及び低反射率状態の両方において約２０未満のC^*値を示す請求項２～１１のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１４】
前記ミラーが、低反射率状態において約２５未満のC^*値を示す請求項２～１１のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１５】
前記ミラーが、高反射率状態及び低反射率状態の両方において約２５未満のC^*値を示す請求項２～１１のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１６】
前記ミラーが、b^*値が、C^*値の約５０％以上に寄与する場合にのみ、高反射率状態及び低反射率状態の一方以上において約２０より大きいC^*値を示す請求項２～１１のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１７】
前記自浄親水性塗膜が、前記自浄親水性塗膜の前面上の水滴が約３０°未満の接触角を示すのに十分親水性である、請求項２～１６のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１８】
前記自浄親水性塗膜が、前記自浄親水性塗膜の前面上の水滴が約２０°未満の接触角を示すのに十分親水性である、請求項２～１６のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。
【請求項１９】
前記自浄親水性塗膜が、前記自浄親水性塗膜の前面上の水滴が約１０°未満の接触角を示すのに十分親水性である、請求項２～１６のいずれかに記載のエレクトロクロミックデバイス。